

ارزیابی اثر فاصله بین اتمی در رسانش الکترونی نانوسیم‌های سیلیکونی

سید محمد اعظمی^۱، سیده زینب موسوی محمده^۲.

۱- دانشگاه یاسوج گروه شیمی

Email: azami_sm@yahoo.com

۲- دانشگاه یاسوج گروه شیمی

Email: z.mousavi319@gmail.com

خلاصه

محاسبات Abintio در سطح محاسباتی HF و با مجموعه پایه *6-31G برای ارزیابی فاصله بین اتمی در رسانش الکترونی نانوسیم‌های سیلیکونی به کار گرفته شده است. نانوساختارهای سیلیکونی با فاصله‌های بین اتمی متفاوت در سیستم‌های یک بعدی مورد بررسی قرار گرفتند. این نانوساختارها دارای تقارن‌های متفاوتی هستند و بسته به نوع تقارن، فواصل بین اتمی نیز متفاوت خواهند بود. هدف از این مطالعه، بدست آوردن فاصله‌ی مناسب، بین اتم‌های سیلیکون است که در آن فاصله بیشترین رسانش سیستم ملاحظه می‌شود.

کلمات کلیدی: رسانش الکترونی، نانوساختار، سیلیکون، HLG

مقدمه

نانوسیم یک سیم به ابعاد یک نانومتر (۱۰-۹ متر) است. در این مقیاس اثرات مکانیکی کوانتومی مهم هستند، از این رو این سیم‌ها به عنوان "سیم‌های کوانتومی" شناخته می‌شوند. انواع مختلفی از نانوسیم‌ها وجود دارد، از جمله فلز (به عنوان مثال، نیکل، Pt، Au) نیمه هادی (به عنوان مثال InP، Si، GaN، و غیره) و عایق (به عنوان مثال، SiO₂، TiO₂) نانوسیم‌های مولکولی از تکرار واحدهای مولکولی یا ارگانیک (به عنوان مثال DNA) یا غیر معدنی (به عنوان مثال MoS₂-xIx) تشکیل